

半導体関連製品

精密洗浄用超高純度アルカリ洗浄液

TMSC

はじめに

"TMSC" は、特に高い清浄度が要求される精密洗浄に最適な洗浄液です。

特徴

Na, K 等のアルカリ金属や、他の重金属をほとんど含まない超高純度洗浄液です。また、Cl 等の陰イオン不純物も含まれておりません。この為、被洗浄体に対する汚染がないことはもちろん、洗浄液の温度を上げて使用した場合でも、Na や Cl によるクリーンルームの汚染が全くありません。

- ・ TMSC の分析結果を以下に示します。
(尚、以下の値は Typical Properties であり Specifications ではありません。)

* 分析方法：フレイムレス原子吸光

洗浄液 (原液)	金属不純物 (ppb)					
	Na	K	Fe	Al	Cu	Ca
TMSC	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0.3	<0.4

上記の結果は、TMSC の原液での結果です。

従来の可燃性有機溶剤や市販の洗剤に比べ、優れた洗浄効果があります。また、広範囲の複合汚染に対して、優れた洗浄効果を示すため、一括洗浄方式による効率的な洗浄を行えますので、薬品、純水使用量の削減が可能です。そのうえ洗浄条件にもよりますが、20 ~ 30 倍の希釈液で十分な洗浄効果が得られるため大変経済的です。

化学組成が安定で、臭いがないため、加熱処理による洗浄も容易に行えます。TMSC は、有機汚染を除き、シリコン、ガラス、及び非鉄金属等の多くに弱いエッチング作用を有し、表面の金属不純物の除去に優れた効果を示します。

有機質汚染の除去にも優れた洗浄効果を示します。例えば、ガラスやシリコン基板上の指紋やワックスに対しても十分な除去作用がありますので、トリクロルエチレン等の毒性の強い溶剤を使用しない洗浄が可能になります。

使用方法

"TMSC" は、以下のようなものの洗浄に適しています。

シリコンウェーハ、水晶ウェーハ、フォトマスク基板、光ディスク基板、コンパクトディスク基板、液晶等のエレクトロニクス関連の各種基板、部品等の洗浄に。

ICP-AES や ICP-MS のネブライザーのような金属不純物を嫌う超微量分析に使用する器具類の洗浄に。

レンズ、プリズム等の光学工業部品の洗浄に。

石英ルツボ、石英管等の各種石英器具の洗浄に。

計測機器の部品やベアリング等の精密工業部品の洗浄に。

取扱い上の注意

本品は、強アルカリ性である為、ゴム手袋や保護眼鏡などの保護具を着用して、皮膚には直接触れない様にしてください。

誤って皮膚、目に触れた場合は、直ちに多量の流水で洗浄してください。

洗浄液の保存に際しては、専用の容器で密閉して室温で保存してください。

使用前には、MSDS を参照してください。